



XPS 走査型デュアルX線光電子分光分析装置

PHI Quantes

装置概要

本装置は軟X線 (Al K α 線) と硬X線 (Cr K α 線) の2種類の単色化線源を用いて、試料表面の元素組成や化学構造の分析が行えます。検出の深さは表面からAl線の数nm、Cr線で10~数十nmです。X線照射により表面から飛び出した電子を、X線を走査しながら検出することでSEM様画像を取得でき、分析箇所を特定できます。Arモノマイオン/Arガスクラスターイオン銃を用いた深さ方向分析やトランスファーベッセルを用いた大気非暴露分析、マッピング分析も可能です。自動中和補正機能により、絶縁物表面の帯電を容易に除去できるため、金属材料だけでなく、高分子材料など多くの材料の分析に利用できます。

利用料金

※1時間当たり

	直接	依頼
工学部	¥1,800	¥4,000
機構内	¥3,500	¥7,400
機構外	¥22,400	¥36,200 + 技術料

利用条件

- 講習会受講と利用者登録が必要です
- 担当職員による受託測定も可能です

その他

利用可能時間	終日 (土日祝含む)
設置場所	工学部 1号館 109室

詳細は担当者にお問合せ下さい

全学技術センター 分析・物質技術支援室

伊藤 広樹 ☒ h-ito@etech.engg.nagoya-u.ac.jp
西村 真弓 ☒ nishimura@etech.engg.nagoya-u.ac.jp
林 育生 ☒ ihayashi@etech.engg.nagoya-u.ac.jp

